

Attorney Docket # 4100-280

Express Mail #EV052763799US
Patent

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of
Josef SCHNEIDER et al.
Serial No.: n/a
Filed: concurrently
For: Creating A Mask For Producing A Printing
Plate

JC955 U.S. PTO
10/027024
12/20/01

LETTER TRANSMITTING PRIORITY DOCUMENT

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

SIR:

In order to complete the claim to priority in the above-identified application under 35 U.S.C. §119, enclosed herewith is the certified documentation as follows:

Application No. **100 63 819.8**, filed on December 21, 2000, in Germany, upon which the priority claim is based.

Respectfully submitted,
COHEN, PONTANI, LIEBERMAN & PAVANE

By



Thomas C. Pontani
Reg. No. 29,763
551 Fifth Avenue, Suite 1210
New York, New York 10176
(212) 687-2770

Dated: December 20, 2001

Handwritten initials: *HS*
SA
4/21/02



jc955 U.S. PTO

10/027024



12/20/01

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 100 63 819.8

Anmeldetag: 21. Dezember 2000

Anmelder/Inhaber: MAN Roland Druckmaschinen AG, Offenbach/DE

Bezeichnung: Maskenerstellung zur Herstellung einer Druckform

IPC: B 41 C 1/055

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 17. Oktober 2001
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Hoß

Maskenerstellung zur Herstellung einer Druckform

Die Erfindung betrifft eine Maskenerstellung zur Herstellung einer Druckform.

5 Es ist allgemein bekannt, dass in vielen technischen Bereichen Masken zur Oberflächenbehandlung (Leiterplattenherstellung) oder auch für Druck- (Tiefdruck, bei dem nicht Druckformen aufgebracht, sondern die Formzylinderoberflächen selbst als Druckformen präpariert werden) bzw. Lithografieprozesse verwendet werden. Das Ziel ist es dabei immer, mit einem Material, das andere
10 Eigenschaften als ein Substrat, also eines Trägers eines hinsichtlich des Maskenmaterials anderen Stoffes, eine bestimmte Struktur (Maske) auf eben dem Substrat zu erzeugen. Die so entstandene Maske dient dann als Ausgangspunkt für weitere Prozesse. Sie soll z.B. das Substrat an bestimmten Stellen vor dem Einwirken anderer Substanzen schützen.

15

Der typische Ablauf einer bisherigen Maskenerstellung gliedert sich in die folgenden Schritte auf:

1. Erstellung eines Films mit der Strukturinformation,
2. Belichtung einer geeigneten photoempfindlichen Schicht auf einem Substrat
20 durch diesen Film mittels einer geeigneten Lichtquelle,
3. Entwicklung/Reinigung zur Ausbildung der Struktur (Maske) auf dem Substrat.

Anschliessend kann als weiterer Schritt beispielsweise Ätzen oder auch die direkte Verwendung der Maske beispielsweise als Druckform im Siebdruck folgen. Mittels dieser Maske werden dort alle nichtdruckenden Stellen abgedeckt. Die Druckfarbe
25 findet nur an den offenen Stellen der Maske Durchlass.

Als eine Alternative zum voran beschriebenen Ablauf ist bereits auch bekannt:

1. Aufbringen einer energiesensitiven Schicht auf das Substrat,
2. direkte Belichtung, bzw. Ablation der Struktur mittels einer geeigneten
30 bildinformationsvariablen Energiequelle wie Laser oder Elektronenstrahl,
3. Entwicklung/Reinigung zur Ausbildung der Struktur (Maske) auf dem Substrat, falls erforderlich.

Diese Alternative findet bereits in der Tiefdruckformherstellung Anwendung. Die Maske wird in der Regel auf den Tiefdruckzylinder übertragen, auf diesem dann in der Regel ein Gelatinerelief verbleibt, dessen Dicke dem Tonwert der Diapositive bzw. -negative entspricht. Beim Ätzen mit Eisenchlorid diffundiert das Eisensalz durch die Gelatine und löst Kupfer auf. Über die unterschiedliche Dicke des Reliefs, über die Wahl entsprechender Ätzbadkonzentrationen und über die Ätzdauer lässt sich die Ätztiefe weitgehend steuern

Hiervon ausgehend ist es die Aufgabe der Erfindung, den Ablauf einer Maskenerstellung, insbesondere zur Herstellung einer Druckform, zu vereinfachen und gleichzeitig die Güte der mittels einer Maske hergestellten Druckformen zu verbessern.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.

Für die Erstellung der Strukturinformation einer Maske wird eine Thermotransferfolie eingesetzt, die durch eine geeignete Zufuhrvorrichtung in Kontakt mit dem Substrat, d.h. der Oberfläche des Druckformträgers gebracht wird. Es kann eine energiesensitive Schicht auch durch direktes Beschichten des Substrats (z.B. durch Tauchbeschichtung, Aufrakeln, Aufsprühen, Aufwalzen oder Betonern mit Fest- oder Flüssigtoner), ggf. in Verbindung mit einem Nachtrocknungs- oder Aushärteschritt aufgebracht werden, auf dieser die Strukturinformation der Maske platziert wird.

25

Die Erstellung der Strukturinformation erfolgt vorzugsweise mittels Laserstrahlung, für Ablation ist vorzugsweise eine Leistungsdichte von mehr als 500 MW/m^2 ggf. gepulst vorgesehen. Dabei wird die Laserstrahlung bild- oder nichtbildmäßig auf geeignete Weise moduliert, um die gewünschte Maske zu erzeugen.

30

Beispielsweise aus der DE 198 11 031 A1 ist ein Verfahren und insbesondere eine Vorrichtung zur Herstellung eines Druckes unter Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers mittels einer bandförmigen Transferfolie und eines Substratzylinders bekannt geworden. Die bekannte Vorrichtung umfasst einen Bandtransportmechanismus, der mit einer mit der einen oder mehrere (Laserdiodenarray) Laserstrahlen aussendenden Bebilderungseinheit gekoppelten Traversiereinheit zusammenwirkt. Damit ist die Transferfolie gleichförmig zur Bewegung über die Substratbreite eines Druckformzylinders bewegbar, wobei der mittels einer Steuerungseinheit in bekannter Weise entsprechend einem zu

übertragenden Bild angesteuerte laserbasierte Thermodruckkopf bei jedem Bildpunkt Wärme auf die Transferfolie einleitet und damit eine punktuelle Übertragung der Beschichtung (Thermomaterial) der Transferfolie vornimmt und wobei über die Rotation des Substratzylinders und die zum Substratzylinder achsparallele Traversierung die komplette Substratoberfläche überstreichbar ist.

Im Falle einer direkt aufgetragenen energiesensitiven Schicht kann die Entwicklung/Reinigung der Schicht mit einer geeigneten Reinigungsvorrichtung evtl. unter Zuhilfenahme von Reinigungsflüssigkeiten erfolgen, also Reinigung durch Flüssigkeits- oder Partikelstrahl, ggf. kombiniert, oder Reinigung durch Bürsten oder Reinigung mittels Waschtuch. Zusätzlich kann die Schicht nach Ausformung der Maske noch thermisch beaufschlagt werden, um ihre Chemikalienbeständigkeit, bzw. mechanischen Eigenschaften zu verbessern.

Das Verfahren auf dem der Erfindungsvorschlag also basiert, ist der laserinduzierte Thermotransfer, wie er zur Herstellung der löschbaren Offsetdruckformen beispielsweise beim Gegenstand der DE 44 30 555 C1 eingesetzt wird. Die Systemanordnung aus den Komponenten Laser und Bandstation, wie aus der DE 44 30 555 C1 oder der DE 198 11 031 A1 bekannt (Thermotransfer-Offpressaufbau), bildet das Vorbild für eine Vorrichtung zur Maskenherstellung.

Der laserinduzierte Thermotransfer bietet gegenüber herkömmlichen Verfahren zur Maskenerstellung den Vorteil, dass er sehr schnell und präzise ist. Durch den laserinduzierten Thermotransfer werden die Prozessschritte des Beschichtens und des Bebilderns zu einem Prozessschritt zusammengefasst. Dadurch können Zeit und Kosten eingespart werden.

Die Bebilderungsqualität des laserinduzierten Thermotransfers ist sehr hoch (Offsetqualität), so dass feinste Strukturen abgebildet werden können.

Das aus dem voran beschriebenen Stand der Technik bekannte Thermotransfermaterial, welches auf die herzustellende Druckform aufgebracht wird, ist geeignet, zur Maskenerstellung durch Belichtung, Auswaschung, bzw. Ätzung eingesetzt zu werden. Das Thermotransfermaterial ist opak (lichtbeständig), wasserfest und insbesondere säureresistent.

Das Thermotransfermaterial muss nicht gesondert aufgebracht werden. Auf dünnen Folienbändern aufgebracht, kommen bekanntlich vorkonfektionierte Bandkassetten zum Einsatz. Außerdem kann sowohl die Erstellung der Maske, als auch die Herstellung einer Druckform mittels dieser Maske innerhalb der Druckmaschine vorgenommen werden.

Weitere Merkmale und Vorteile ergeben sich aus den Unteransprüchen in Verbindung mit der Beschreibung.

Nachfolgend wird die Erfindung näher erläutert. In der zugehörigen Zeichnung zeigt schematisch, die

- Fig. 1 ein Maschinengestell mit Komponentenanordnung zur Maskenerstellung,
- Fig. 2 eine Maskenerstellung mittels laserinduziertem Thermotransfer zur Druckformherstellung,
- Fig. 3 bis 5 Details der Maskenerstellung zur Tiefdruckformherstellung,
- Fig. 6 bis 8 Details der Maskenerstellung zur Flexodruckformherstellung,
- Fig. 9 bis 11 Details der Maskenerstellung zur Siebdruckformherstellung und
- Fig. 12 bis 14 Details der Maskenerstellung zur galvanischen Siebdruckformherstellung.

Fig. 1 (und Fig. 2) zeigt einen Druckformzylinder 1, auf dessen Oberfläche eine Maske erstellt werden soll. Ein Bandtransportmechanismus 2, eine Vorrats- 3 und eine Aufwickelrolle 4 umfassend, führt eine bandförmige Thermotransferfolie 5 nahe an der Oberfläche des Druckformzylinders 1, bzw. bringt diese in Kontakt mit der Oberfläche des Druckformzylinders 1. Eine Laser-Bebilderungseinheit 6 fokussiert eine oder mehrere Laserstrahlen 7 auf die Thermotransferfolie 5. Die Laser-Bebilderungseinheit 6 und der Bandführungsmechanismus 2 sind in bekannter Weise gemeinsam auf einer Traversiereinheit 8 angeordnet, mittels dieser sie in einem Maschinengestell 9 über die Breite des Druckformzylinders 1 bewegt werden können.

In Fig. 2 ist nochmals dargestellt, wie die Vorrichtung gemäss der Fig. 1 in einer Tiefdruckmaschine zum Einsatz kommt, um eine Ätzmaske 10 (Fig. 3, bzw. 4) mittels laserinduziertem Thermotransfer auf der Oberfläche 11 eines

Tiefdruckzylinders zu erstellen, indem Thermotransfermaterial 5b als Bildinformation 5c, bzw. Strukturinformation für die Ätzmaske 10 übertragen wird.

5 Gemäss der Fig. 3 bis 5 kann also eine Maskenerstellung mittels laserinduziertem Thermotransfer zur Herstellung einer Tiefdruckform 13 verwendet werden. Dabei handelt es sich um ein Ätzverfahren, bei welchem in herkömmlicher Weise mittels Eisen-III-Chlorid (Fe_3Cl) Bildinformationen auf einen Druckzylinder mit einer Kupferoberschicht geätzt werden können. In Fig. 3 ist der Vorgang der Maskenerstellung für eine Tiefdruckform angedeutet und es sind die gleichen
10 Bezugszeichen für gleiche Teile der Fig. 1 und 2 verwendet.

Fig. 4 (und Fig. 3) zeigt den Ätzvorgang im Tiefdruck mit Hilfe einer erfindungsgemäss hergestellten Ätzmaske 10. Mit dieser Ätzmaske 10, die auf die Zylinderoberfläche 11 aufzubringen ist, wird eine Differenzierung hinsichtlich
15 Bildstellen und Nicht-Bildstellen (Bildinformation 5c) vorgenommen. Die Ätzmaske 10 wird von der Transferfolie 5 in Form des Thermotransfermaterials 5b als Negativmaske aufgebracht, so dass die beabsichtigten Bildstellen 14 als freie und nicht abdeckende Bereiche erkennbar sind. Die Nicht-Bildstellen 15 müssen bedeckt und geschützt sein. Nach dem Aufbringen der bilddifferenzierenden
20 Maske 10 kann die Tiefdruckform 13 geätzt werden, wobei durch das Aufbringen von Säure 16 die Zylinderoberfläche 11 an den Bildstellen 14, d.h. den ungeschützten Bereichen, durch den Ätzprozess angegriffen bzw. vertieft, und damit Tiefdruckknäpfchen 18 ausgebildet werden. Die Säure 16 greift durch eine chemische Reaktion das Oberflächenmaterial, im allgemeinen bei Tiefdruckformen
25 das Kupfer, an und löst dieses auf.

Das Material 5b, welches die bilddifferenzierende Maske 10 bildet, muss beständig gegen Säure sein und darf von dieser nicht angegriffen werden. Durch diese Beständigkeit wird die Bilddifferenzierung bzw. die Bilderzeugung auf der
30 Tiefdruckform 13 gewährleistet. Das Maskenmaterial 5b wird auch als Ätzresistenz oder Ätzreserve bezeichnet. Die Haftung des Maskenmaterials 5b auf der Druckformoberfläche 11 muss fest und gleichmässig sein. Es muss gewährleistet sein, dass die Säure 16 die Maske 10 nicht unterlaufen bzw. unterfluten kann. Diese Haftungsfestigkeit garantiert gleichzeitig eine kantenscharfe und exakte
35 Bilderzeugung, welches hauptsächlich bei Linien und Schriften von grösster Bedeutung und Notwendigkeit ist. Die für den Tiefdruck notwendigen rakeltragenden Strukturen (Stege 17) müssen dabei über entsprechende Bilddatengenerierungen bei der Maskenerstellung durch die Laserbebilderung gewährleistet sein.

40

Für die Maskenerstellung mittels laserinduziertem Thermotransfer kommt allgemein ein Polymermaterial zum Einsatz, welches in dünnen Schichten auf einem Folienträger aufgebracht ist. Diese beschichtete Thermotransferfolie 5 ist wie eingangs beschrieben auf einer Vorratsrolle 3 aufgewickelt und wird über eine entsprechende Vorrichtung bei dem Vorgang der Maskenerstellung abgewickelt. Die Führung des Folienbandes 5 ist in der Art ausgerichtet, dass die mit dem Maskenmaterial 5b beschichtete Seite der Folie 5 der Oberfläche des Druckformzylinders 1 zugeordnet ist. In der Vorrichtung ist neben der Folienbandführung 2 ein Lasersystem 6 zur Bilderzeugung integriert. Dieses vorzugsweise diodengepumpte YAG-Lasersystem 6 überträgt die Bildsignale von einem digitalen Datenbestand mittels energiereicher Laserimpulse auf die Rückseite der mit dem Maskenmaterial 5b beschichteten Folie 5. Der Abstand der Folie 5 zur Zylinderoberfläche muss dabei sehr gering sein, so dass das Maskenmaterial 5b sobald die energiereiche Laserstrahlung 7 auf die Folienrückseite trifft, von der Folienvorderseite mit ausreichender Exaktheit und Vollständigkeit auf die Oberfläche des Zylinders 1 transportiert werden kann.

Die Zylinderrotationsgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit des Folienbandvorschubs werden von der Leistungsfähigkeit des Lasersystems bestimmt. Der seitliche Vorschub in paralleler Richtung der Zylinderachse wird durch die Anzahl der Laserdiodenarrays vorgegeben. Das Prinzip der rotativen Bebilderung mit seitlich traversierendem Vorschub gewährleistet die Möglichkeit einer nahtlosen Maskenerstellung auf der zu bearbeitenden Tiefdruckwalze.

Bei der laserinduzierten Maskenerstellung handelt es sich um ein autotypisches Bildaufbauverfahren, d.h. das die Bildinformation flächenvariabel bei gleichzeitiger Schichtdickenkonstanz aufgetragen wird. Die Maske muss zur erfolgreichen Verarbeitung beim Ätzprozess im Negativverfahren übertragen worden sein. Die Bildstellen 14, also die Tiefdruckknäpfchen 18, die auf der Tiefdruckform nach dem Ätzen vertieft liegen sollen, müssen nach der Maskierung erkennbar freiliegen, d.h. diese Bereiche dürfen von der Ätzmaske 10 nicht bedeckt sein. Die Nicht-Bildstellen 15 müssen von der Negativmaske erkennbar bedeckt werden. Die Fig. 5 zeigt eine solche geätzte Tiefdruckform 13 mit bereits entfernter Ätzmaske und mit geätzten Tiefdruckknäpfchen 18 und Rasterstegen 17.

Der Vorteil dieses laserinduzierten Maskierverfahrens liegt in der gleichzeitigen Erstellung einer ätzresistenten Maske und der Übertragung der Bildinformationen. Durch dieses Verfahren wird die Trennung des Auftrags der Substratbeschichtung und des ablativen Bebilderns (also Maskenerstellung) aufgehoben. Die Bebilderung mittels Laserdiodenarrays erlaubt kurze

Bebildungszeiten, durch geringere erforderliche Energieleistungen und höheren Vorschubgeschwindigkeiten in seitlich paralleler Achsrichtung.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Güte der Bebilderung begründet. Das Auflösungsvermögen einer laserinduzierten Bebilderung ist im Vergleich zu einer ausschließlich ablativen Laserbebilderung oder einer mechanischen Stichelgravur um ein Vielfaches höher. Die bekannten Schwächen des Tiefdrucks bei der Wiedergabe von kantenscharfen Linien und runden Schriftelementen können mit diesem Maskiervfahren mittels laserinduziertem Thermotransfer beseitigt werden.

Die Fig. 6 deutet in einem weiteren Ausführungsbeispiel vorliegender Erfindung eine Maskenerstellung zur Herstellung einer Flexodruckform 20 an, Fig. 7 skizziert einen Kopiervorgang einer Flexodruckform 20 mittels Maske 21 und Fig. 8 zeigt eine entwickelte Flexodruckform 20 mit bereits entfernter Maske.

Gemäss den Fig. 6 bis 8 kann also die Maskenerstellung mittels laserinduziertem Thermotransfer des weiteren zur Herstellung einer Flexodruckform 20 verwendet werden. Dabei handelt es sich um ein Kopierverfahren, bei welchem die Bildinformationen mittels einer Kopiermaske 21 und energiereicher Strahlung (z.B. UV-Licht aus einer Kopierlampe 22, Fig. 7) auf eine lichtempfindliche Beschichtung 23 einer Flexodruckform 20 übertragen werden. Mit der Kopiermaske 21 wird eine Differenzierung hinsichtlich Bildstellen 24 und Nicht-Bildstellen 25 (Figs. 6 und 7) vorgenommen. Voraussetzung für den Kopierprozess zur Herstellung einer Flexodruckform 20 ist, dass der Flexodruckzylinder bzw. die Hülse (Sleeve), die auf diesen aufgeschoben werden kann, ebenso die Rohplatte, die auf einen entsprechenden Zylinder aufgespannt werden kann, mit einem lichtempfindlichen Material 23 vorbeschichtet worden ist.

Dieses Beschichten ist nicht Bestandteil der Flexodruckformherstellung, sondern wird von entsprechenden Herstellern bzw. Lieferanten als Rohmaterial vorgefertigt geliefert. Bei diesen Vorbeschichtungen gibt es sogenannte Negativ- bzw. Positivmaterialien, d.h. dass die Belichtung dieser Kopiermaterialien zum einen mittels einer Positivkopiermaske oder zum andern mittels einer Negativkopiermaske erfolgen kann.

Bei einer Negativkopie werden die von der Strahlung einer Kopierlampe 22 getroffenen Bereiche (Bildstellen 24) verändert (z.B. gehärtet), die nicht

bestrahlten Bereiche (Nicht-Bildstellen 25) können in einem Entwicklungsprozess ausgewaschen werden (Fig. 8).

5 Somit resultieren die Bildstellen 24 aus den durchlässigen Bereichen der Negativmaske 21, die Nicht-Bildstellen 25 ergeben sich aus den abgedeckten Bereichen der Maske 21. Nach dem Entwickeln bzw. Auswaschen der mittels Negativkopie belichteten Flexodruckform 20 mit einer entsprechenden Lösung stehen die gehärteten Bildelemente 24 erhaben hervor (Fig. 8) und können als Flexodruckform 20 auf einem Flexodruckzylinder eingesetzt werden.

10

Bei einer Positivkopie werden die von der energiereichen Strahlung (z.B. UV-Licht) getroffenen Bereiche verändert (z.B. zerstört), die nicht bestrahlten Bereiche bleiben unverändert erhalten. Beim Entwicklungsprozess bzw. Auswaschen der mittels Positivkopie belichteten Rohplatte bzw. Zylinder werden die durch
15 Bestrahlung zerstörten Bereiche mit einer entsprechenden Lösung ausgewaschen. Die nicht bestrahlten Stellen bleiben erhaben stehen und können ihrerseits als Flexodruckform eingesetzt werden.

20 Die mittels laserinduziertem Thermotransfer übertragene Maske 21 dient bei der Flexodruckformherstellung ausschließlich zur Übertragung der Bildinformationen 5c durch Kopie bzw. durch Bestrahlung mit energiereichem Licht (z.B. UV-Licht). Die Aufgabe der Kopiermaske 21 ist eine ausreichende Opazität bei der Bestrahlung zu gewährleisten. Die Bildinformationen müssen exakt und kantenscharf abgebildet werden können. Durchscheinen und Fehlstellen in der
25 Maske 21 führen zu Fehlstellen auf der Flexodruckform 20. Für den Prozessschritt des Entwickelns bzw. Auswaschens wird die Kopiermaske 21 nicht mehr benötigt.

30 Die Ausführung der Maskenerstellung mittels laserinduziertem Thermotransfer gleicht der Ausführung der des Tiefdrucks bis auf den Umstand, dass bei der Maskenerstellung für die Flexodruckformherstellung sowohl Negativkopiermasken als auch Positivmasken zum Einsatz kommen können. Bei der Flexodruckformherstellung wird die Maske zur Belichtung mit energiereicher Strahlung (z.B. UV-Licht) eingesetzt und kommt bei der Übertragung von Bildinformationen nicht mit flüssigen Medien in Berührung. Die Vorrichtung zur
35 Herstellung der Kopiermaske 21 zur Flexodruckformherstellung ist mit der der Tiefdruckmaskenerstellung identisch.

Der Vorteil hier liegt in der gleichzeitigen Erstellung einer opaken Kopiermaske und der Übertragung der Bildinformationen. Durch dieses Verfahren wird die

Trennung des Maskierverfahrens und des ablativen Bebilderns aufgehoben. Somit können zwei Verfahrensschritte zur Maskierung einer Kopierform auf einen Prozessschritt verkürzt werden. Die Bebilderung mittels Laserdiodenarray erlaubt kurze Bebilderungszeiten durch geringere erforderliche Energieleistungen und höheren Vorschubgeschwindigkeiten in seitlich paralleler Achsrichtung. Ein weiterer Vorteil liegt in der Güte der Bebilderung begründet. Das Auflösungsvermögen einer laserinduzierten Bebilderung ist im Vergleich zu einer ausschließlich ablativen Laserbebilderung höher. Durch diese Vorteile resultieren einerseits Zeitersparnisse beim Prozessablauf und andererseits Kosteneinsparungen bei den Vorrichtungsaufbauten durch eingesparte Komponenten.

Gemäss den Fig. 9 bis 14 kann die Maskenerstellung mittels laserinduziertem Thermotransfer aber auch zur Herstellung einer Siebdruckform verwendet werden. So kann es sich entweder um ein Kopierverfahren (Fig. 9 bis 11) oder um ein Maskierverfahren für einen galvanischen Herstellungsprozess (Fig. 12 bis 14) handeln.

Bei dem Kopierverfahren für den Siebdruck (Fig. 9) werden sogenannte Siebdruckschablonen 30 (Siebdruckform, Fig. 11) hergestellt, wobei es sich meistens um eine netzartige Gewebestruktur 31 (Siebdruckgewebe) handelt, die in einem Rahmen oder in einem geeigneten Gestell eingespannt wird. Dieses netzartige Gewebe wird mit einer lichtempfindlichen Schicht 32 vollständig beschichtet und kann mit einer geeigneten Maske 33 zur Übertragung von Bildinformationen 5c mit energiereicher Strahlung (z.B. UV-Licht aus einer Kopierlampe 34) bestrahlt werden.

Die Fig 10 zeigt den Kopiervorgang zur Siebdruckformherstellung mittels Maske 33. Für den Kopierprozess können abhängig von dem zum Einsatz kommenden Maskenmaterial Positiv- oder Negativmasken eingesetzt werden. Bei Negativmasken werden die freiliegenden Bereiche der Maske zu Nicht-Bildstellen auf der Siebdruckform. Die von der Strahlung getroffenen Bereiche der lichtempfindlichen Schicht werden gehärtet und bleiben beim Entwickeln bzw. Auswaschen der Druckform erhalten. Nichtgehärtete Bereiche der lichtempfindlichen Schicht auf der Druckform werden ausgewaschen und bilden somit die durchlässigen Bildstellen auf der Siebdruckform. Bei Positivmasken 33 ist dieses Funktionsprinzip umgekehrt, d.h. die von der Strahlung getroffenen Bereiche (Bildstellen 36) werden zerstört und beim Entwickeln ausgewaschen. Hierbei werden die freiliegenden Bereiche zu Bildstellen 36, bzw. die abgedeckten Bereiche zu Nicht-Bildstellen 37 auf der Siebdruckform 30. Die mittels

laserinduziertem Thermotransfer übertragene Maske 33 dient bei der Siebdruckformherstellung auf netzartigen Geweben 31 ausschließlich zur Übertragung der Bildinformationen durch Kopie bzw. durch Bestrahlung mit energiereichem Licht (z.B. UV-Licht).

5

Die Kopiermaske 33 muss eine ausreichende Opazität bei der Bestrahlung gewährleisten. Die Bildinformationen müssen exakt und kantenscharf abgebildet werden können. Durchscheinen und Fehlstellen in der Maske 33 führen zu Fehlstellen auf der Siebdruckform 30. Für den Prozessschritt des Entwickelns bzw. Auswaschens wird die Kopiermaske 33 nicht mehr benötigt.

10

Gemäss der Fig. 12 wird bei dem galvanischen Herstellungsprozess einer Siebdruckform (45, Fig. 14) die Maskenerstellung mittels laserinduziertem Thermotransfer dazu verwendet, um auf einem Zylinder (Grundzylinder 40) mit einer metallischen Oberfläche (Trennschicht aus Metall 42) eine Maske (positiv) 41 zu verankern, die die Bildinformationen in Bild- 44 bzw. Nicht-Bildstellen 46 trennt. Der metallische Zylinder (Grundzylinder 40, evt. Mit Trennschicht 42) wird mit der entsprechenden Maske 41 einem elektrolytischen Bad (Elektrolyt 43) ausgesetzt. Das Thermotransfermaterial 5b, 5c der Maske 41 dient dabei als Isolator, so dass an den Stellen bzw. Bereichen (Bildstellen 44), an denen sich die Maske 41 auf der Oberfläche (Trennschicht 42) des Grundzylinders 40 befindet, keine elektrische Ladung fließen kann (die metallische Trennschicht 42 ist negativ, der Elektrolyt 43 ist positiv geladen, Fig. 13). Somit kann an diesen durch die Maske 41 abgedeckten Stellen 44 kein Metallniederschlag stattfinden, d.h. die Wirkung des Absetzens von Metall (z.B. Kupfer, Nickel) durch das Elektrolytbad kann durch diese Maskierung bildmäßig gesteuert werden. Nach Abschluss des vollständigen Elektrolytprozesses (galvanischer Herstellungsprozesses) kann beispielsweise eine Hülse (Sleeve) von dem metallischen Zylinder (Grundzylinder 40) abgezogen werden, welche dann als Siebdruckform 45 nutzbar ist. An den Stellen 44, an denen die Positivmaske 41 auf dem Grundzylinder 40, 42 die Oberfläche abgedeckt hat, sind auf der Siebdruckform 45 (Hülse) entsprechende Löcher bzw. Bildstellen 41 vorhanden (Fig. 11). Diese Löcher dienen beim Siebdruck als farbführende Stellen (Farbdurchlass des Siebes), durch die die Farbe mit entsprechenden Rakeln auf die Bedruckstoffe geführt werden kann.

35

Die Maskenerstellung mittels laserinduzierten Thermotransfer dient bei diesem Siebdruckformherstellungsprozess als bilddifferenzierende Galvanikmaske 41. Die Maske 41 wird dabei einem flüssigen Elektrolytbad 43 ausgesetzt und muss gegen Anlösen und Unterlaufen resistent sein. Die Bildinformationen müssen exakt und kantenscharf abgebildet werden können. Die für den Siebdruck

40

notwendigen rakeltragenden Strukturen müssen dabei über entsprechende Bilddatengenerierung bei der Maskenerstellung durch die Laserbebilderung gewährleistet sein.

- 5 Die Ausführung der voran beschriebenen Maskenerstellung gleicht der Ausführung des anfangs beschriebenen Tiefdrucks bis auf den Umstand, dass bei der Maskenerstellung für die Siebdruckformherstellung auf netzartigen Geweben sowohl Negativkopiermasken als auch Positivkopiermasken zum Einsatz kommen können. Bei der Siebdruckformherstellung auf Geweben wird die Maske zur
10 Belichtung mit energiereichen Strahlen (z.B. UV-Licht) eingesetzt und kommt bei der Übertragung von Bildinformationen nicht mit flüssigen Medien in Berührung. Bei der galvanischen Siebdruckformherstellung werden Positivmasken mittels laserinduziertem Thermotransfer hergestellt. Dabei kommt die Maskierung mit flüssigen Medien (Elektrolytbäder) in Berührung. Die Vorrichtung zur Herstellung
15 einer Kopiermaske für die Siebdruckformherstellung ist allerdings mit der Vorrichtung für die Tiefdruckmaskenerstellung identisch.

- Der Vorteil dieses laserinduzierten Maskierverfahrens für die Siebdruckformherstellung liegt wiederum in der gleichzeitigen Erstellung einer
20 Maske und der Übertragung der Bildinformationen. Durch dieses Verfahren wird die Trennung des Maskierverfahrens und des ablativen Bebilderns aufgehoben. Somit können zwei Verfahrensschritte zur Maskierung einer Kopierform bzw. einer galvanischen Grundform auf einen Prozessschritt verkürzt werden. Die Bebilderung mittels Laserdiodenarrays erlaubt kurze Bebilderungszeiten, durch
25 geringere erforderliche Energieleistungen und höheren Vorschubgeschwindigkeiten in seitlich paralleler Achsrichtung. Ein weiterer Vorteil liegt in der Güte der Bebilderung begründet. Das Auflösungsvermögen einer laserinduzierten Bebilderung ist im Vergleich zu einer ausschließlich ablativen Laserbebilderung höher. Durch diese Vorteile resultieren einerseits
30 Zeitersparnisse beim Prozessablauf und andererseits Kosteneinsparungen bei den Vorrichtungsaufbauten durch eingesparte Komponenten.

Bezugszeichenliste

	1	Druckformzylinder (Druckformträger)
	2	Bandtransportmechanismus
	3	Vorratsrolle
5	4	Aufwickelrolle
	5	Thermotransferfolie
	5b	Thermotransfermaterial
	5c	Bildinformation (Strukturinformation)
	6	Laser-Bebilderungseinheit
10	7	Laserstrahl
	8	Traversiereinheit
	9	Maschinengestell
	10	Ätzmaske (Tiefdruck)
	11	Tiefdruckzylinderoberfläche (Druckformträger)
15	13	Tiefdruckform
	14	Bildstellen (Tiefdruck)
	15	Nicht-Bildstellen (Tiefdruck)
	16	Säure
	17	Rasterstege
20	18	Tiefdruckknäpfchen
	20	Flexodruckform
	21	Kopiermaske (Flexodruck)
	22	Kopierlampe
	23	Lichtempfindliche Beschichtung (Druckformträger)
25	24	Bildstellen (Flexodruck)
	25	Nicht-Bildstellen (Flexodruck)
	30	Siebdruckschablone (Siebdruckform)
	31	Siebdruckgewebe (Druckformträger)
	32	Lichtempfindliche Beschichtung
30	33	Kopiermaske (Siebdruck)
	34	Kopierlampe
	36	Bildstellen (Siebdruck)
	37	Nicht-Bildstellen (Siebdruck)
	40	Grundzylinder (Siebdruck, Druckformträger)
35	41	Maske, positiv (Siebdruck)
	42	Trennschicht
	43	Elektrolyt

- 44 Bildstelle (Farbdurchlass des Siebes)
- 45 Siebdruckform
- 46 Nicht-Bildstelle (Stegstruktur des Siebes)

Patentansprüche

1. Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers für eine Maskenerstellung zur Herstellung einer Druckform, wobei bei der Maskenerstellung mittels einer Thermotransferfolie (5) und einer Laser-Bebildereinheit (6) zur Ablation des Thermotransfermaterials (5b) die Strukturinformation (5c) der Maske (10, 21, 33, 41) auf die Oberfläche eines Druckformträgers (1; 11, 23, 31, 40) direkt aufgebracht wird, so dass eine Differenzierung hinsichtlich Bildstellen (14, 24, 36, 44) und Nicht-Bildstellen (15, 25, 37, 46) direkt auf dem Druckformträger (1; 11, 23, 31, 40) zur Ausbildung einer Druckform (13, 20, 30, 45) vorgenommen werden kann.
2. Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Herstellung einer Tiefdruckform (13).
3. Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers nach Anspruch 2, gekennzeichnet dadurch, dass auf einer Zylinderoberfläche (11) mittels des Thermotransfermaterials (5b) eine Ätzmaske (10) in Form einer Negativmaske erstellt wird und durch Säureauftrag (16) Tiefdruckknäpfchen (18) geätzt werden können.
4. Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers nach Anspruch 3, gekennzeichnet dadurch, dass bei der laserinduzierten Maskenerstellung ein autotypisches Bilddatenverfahren durchgeführt wird, so dass die Bildinformation (5c) bzw. die Strukturinformation der Ätzmaske (10) flächenvariabel bei gleichzeitiger Schichtdickenkonstanz aufgetragen wird.
5. Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Herstellung einer Flexodruckform (20)

6. Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch die Erstellung einer Kopiermaske (21) auf einer lichtempfindlichen Beschichtung (23) des Druckformträgers, so dass zur Herstellung der Flexodruckform (20) mittels einer Kopierlampe (22) eine Differenzierung hinsichtlich Bildstellen (24) und Nicht-Bildstellen (25) auf der lichtempfindlichen Beschichtung (23) vorgesehen werden kann.
7. Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers nach Anspruch 6, gekennzeichnet durch die Erstellung der Kopiermaske (21) als Positivkopiermaske.
8. Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers nach Anspruch 6, gekennzeichnet durch die Erstellung der Kopiermaske (21) als Negativkopiermaske.
9. Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Herstellung einer Siebdruckform (30, 45).
10. Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers nach Anspruch 9, gekennzeichnet durch die Erstellung einer Kopiermaske (33) für ein Kopierverfahren.
11. Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers nach Anspruch 9, gekennzeichnet durch eine Siebdruckmaske (41) für ein galvanische Siebdruckformherstellung.
12. Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch eine Erstellung der Kopiermaske (33), bei der eine netzartige Gewebestruktur (31) mit einer lichtempfindlichen Schicht (32) vollständig beschichtet wird, die Schicht (32) mit der Strukturinformation (5c) der Maske belegt wird und mittels einer Kopierlampe (34) eine Differenzierung hinsichtlich Bildstellen (36) und Nicht-Bildstellen (37) vorgenommen wird.
13. Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch die Erstellung der Kopiermaske (33) als Positivmaske.
14. Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch die Erstellung der Kopiermaske (33) als Negativmaske.

- 5 15. Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch die Erstellung der Siebdruckmaske (41) auf der Oberfläche eines metallischen Druckformträgers (40, 42), so dass eine Differenzierung hinsichtlich Bildstellen (44) und Nicht-Bildstellen (46) mittels eines Elektrolyten (43) vorgenommen werden kann, wobei die Strukturinformation (5c) der Siebdruckmaske (41) als Isolator dient und so eine Positivmaske ausgebildet wird.
- 10 16. Verwendung des laserinduzierten Thermotransfers nach einem der vorangehenden Ansprüchen, gekennzeichnet dadurch, dass sowohl die Erstellung der Maske, als auch die Herstellung einer Druckform mittels dieser Maske innerhalb der Druckmaschine vorgenommen wird.

Zusammenfassung

Maskenerstellung zur Herstellung einer Druckform

5 Um den Ablauf einer Maskenerstellung, insbesondere zur Herstellung einer
Druckform 1, zu vereinfachen und gleichzeitig die Güte der mittels einer Maske
hergestellten Druckform 1 zu verbessern, ist die Verwendung des laserinduzierten
Thermotransfers vorgesehen, wobei bei der Maskenerstellung mittels einer
Thermotransferfolie 5 und einer Laser-Bebilderungseinheit 6 die
10 Strukturinformation 5c der Maske auf die Oberfläche eines Druckformträgers direkt
aufgebracht wird, so dass mittels der aufgetragenen Strukturinformation 5c eine
Differenzierung hinsichtlich Bildstellen und Nicht-Bildstellen direkt zur Herstellung
einer Druckform 1 vorgenommen werden kann

(Fig. 2)

15

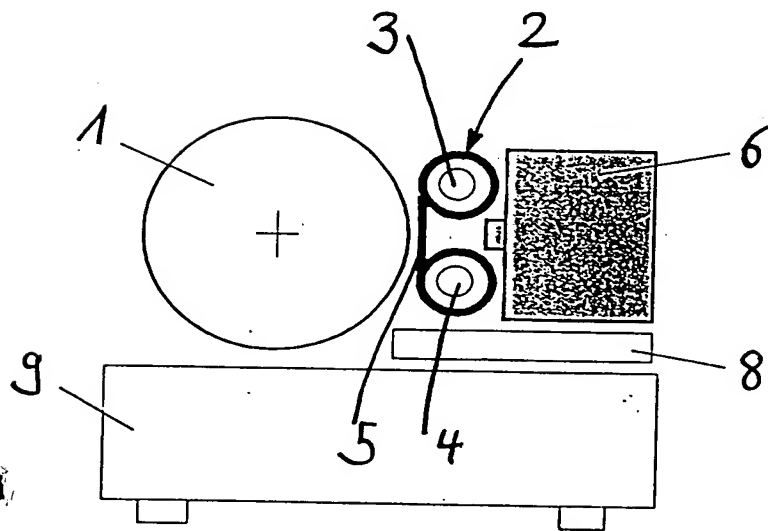


Fig. 1

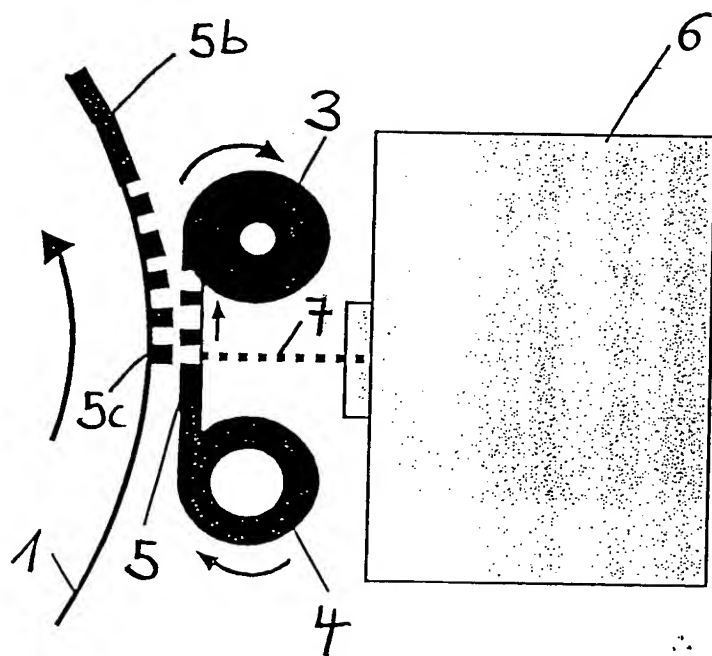


Fig. 2

Fig. 3

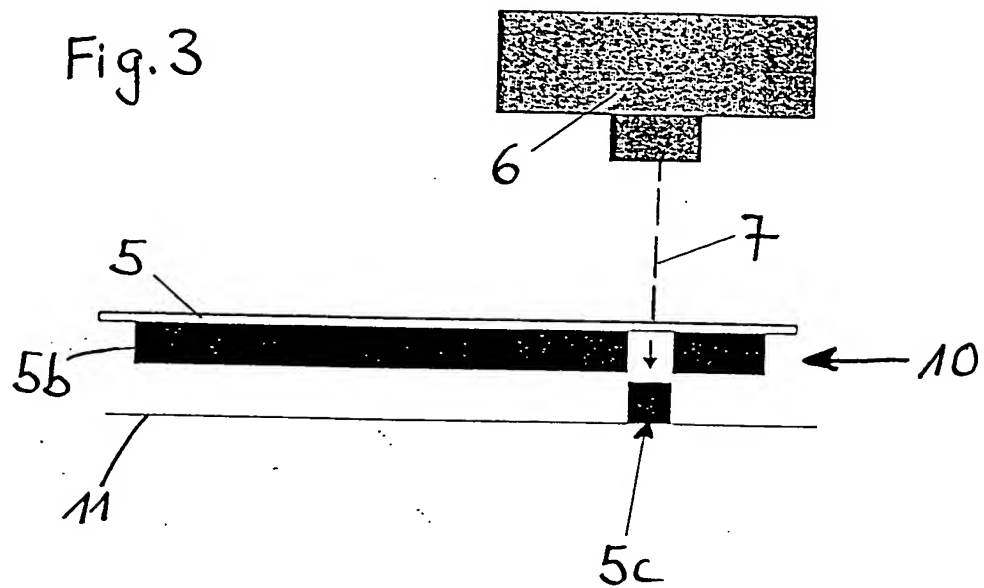


Fig. 4

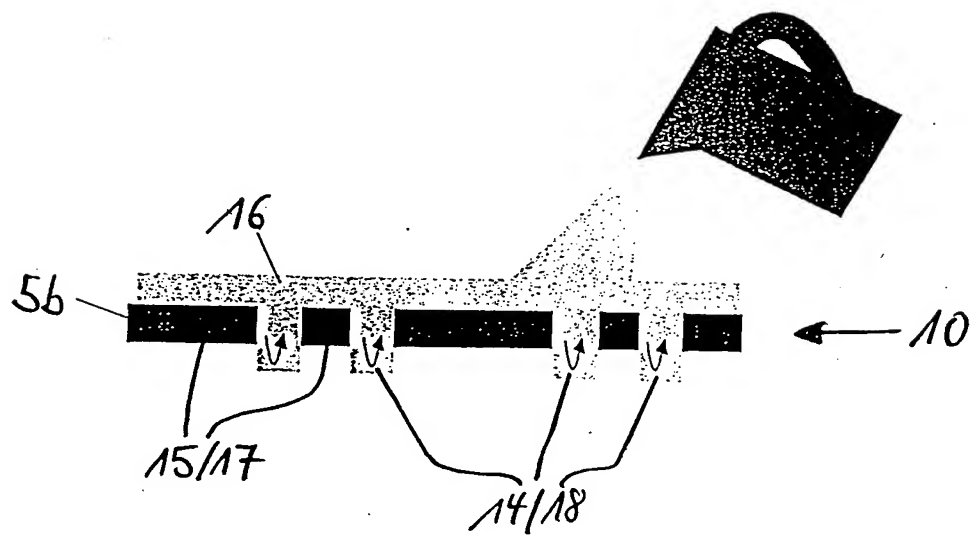


Fig. 5

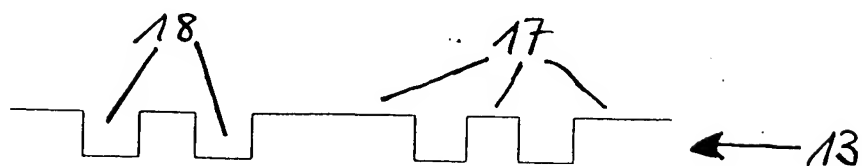


Fig. 6

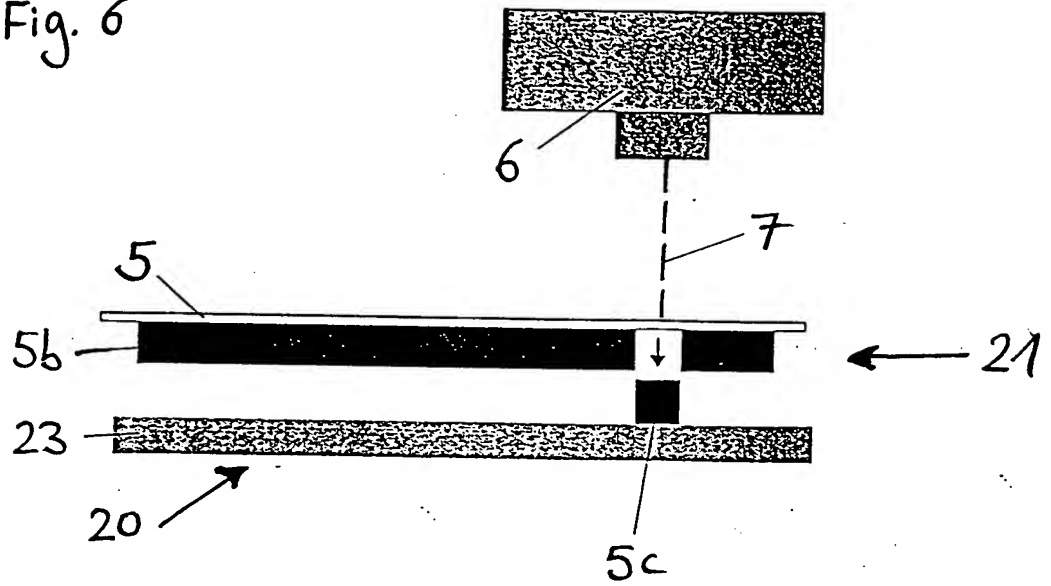


Fig. 7

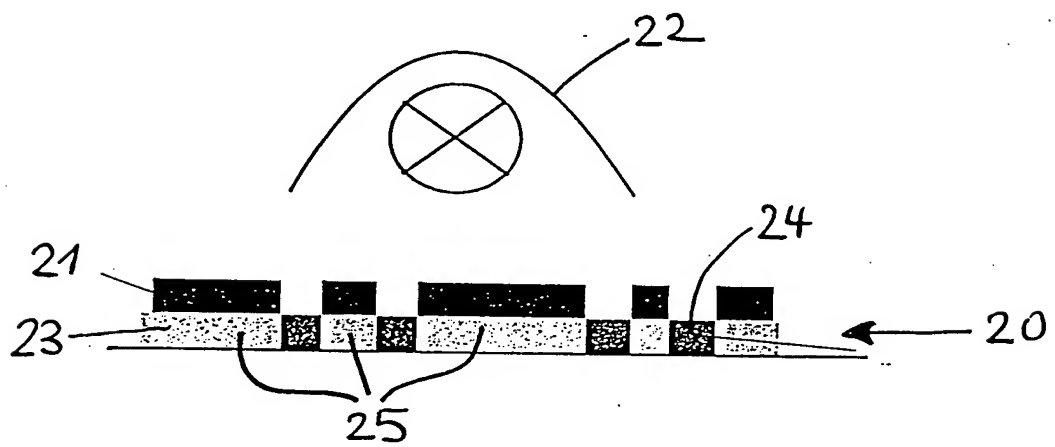


Fig. 8

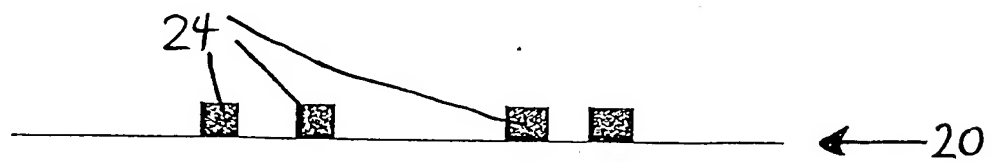


Fig. 9

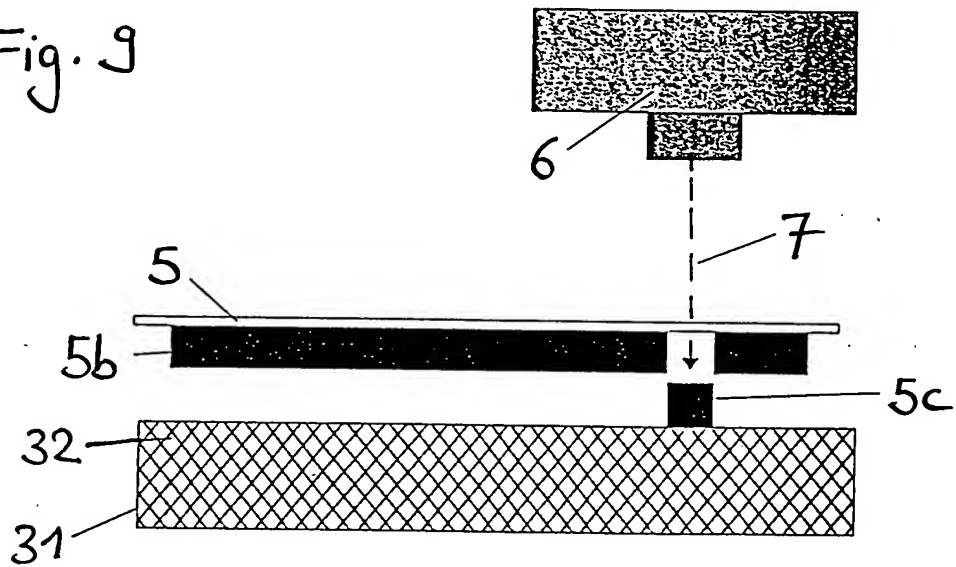


Fig. 10

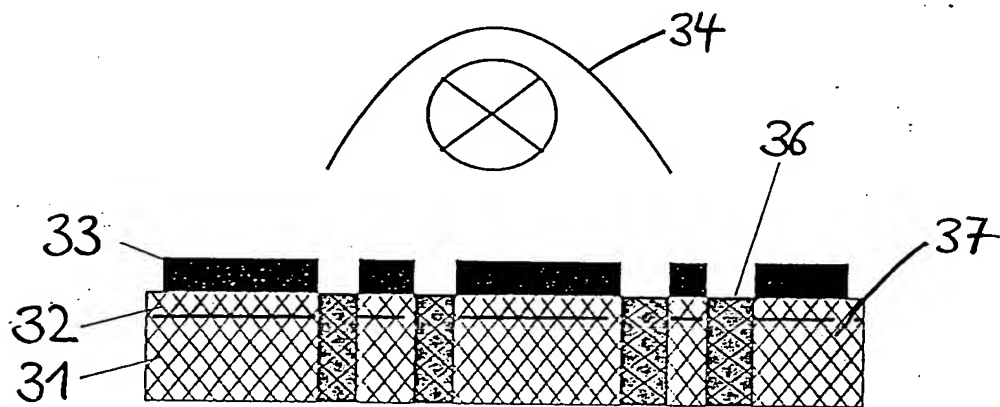


Fig. 11

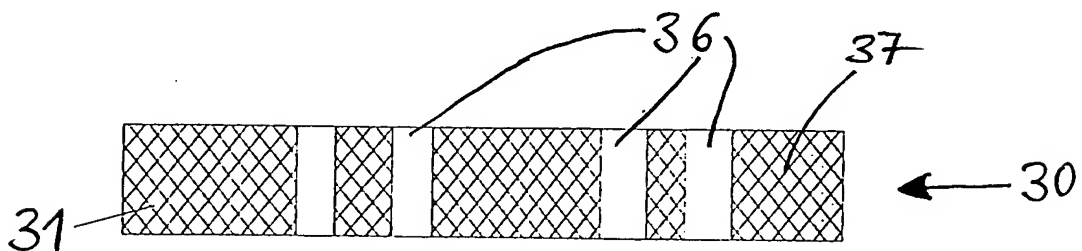


Fig. 12

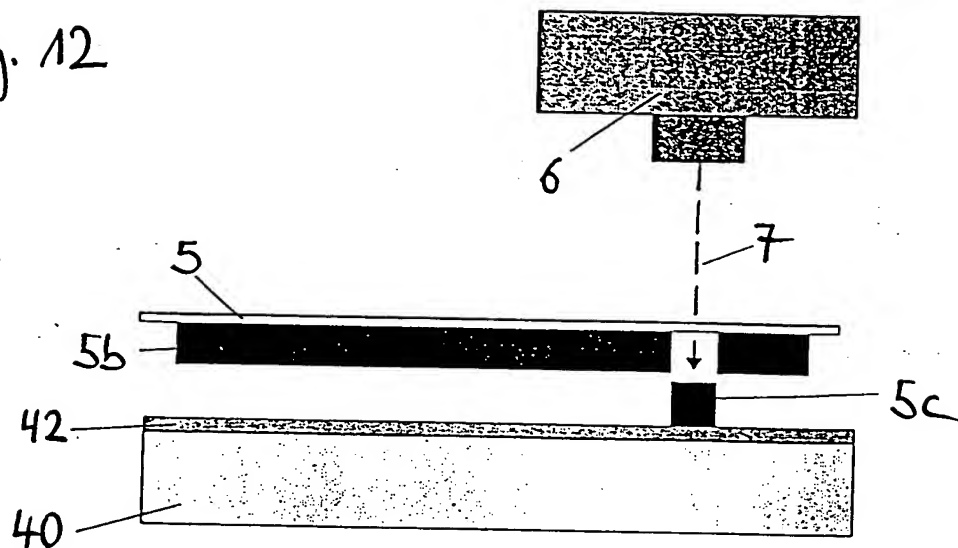


Fig. 13

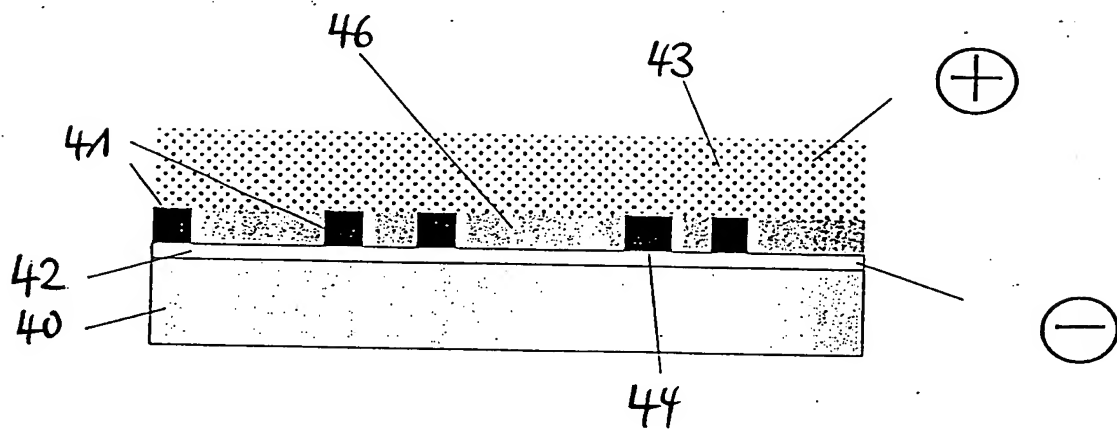


Fig. 14

